



## 報道発表

2011年10月1日

報道関係各位

# DFEB 技術をリードする D2S の日本法人に新社長 — 半導体製造技術に詳しい経営者が就任 —

コンピュータショナル・デザイン・プラットフォーム（高度なソフトウェアと半導体 IP を含む設計環境）を提供するベンチャー企業である D2S, Inc. の日本法人、株式会社 D2S（本社：横浜市港北区新横浜）は、10月1日付けで代表取締役社長に立石正博が就任したことを本日発表しました。立石正博は KLA テンコール株式会社、PDF Solutions, Inc. 等のマネジャーや役員を歴任し、半導体製造技術関連業界におけるビジネス・デベロップメント、顧客サービス、それに経営者としての豊富な経験を有しています。D2S ではこの経験を生かして、日本の誇る EB 装置メーカーやフォトマスクメーカー、あるいは半導体デバイスメーカーとの協力関係を強化すると共に、日本市場における事業の拡大を目指します。またアジア市場における D2S, Inc. の事業拡大の支援も行っております。

D2S は DFEB (Design for e-beam) 技術として、マスクレス技術である EB 直接描画 (EB Direct Writing) に加えて、次世代半導体プロセス・ノードに必要な高解像度のマスクを高い費用対効果で実現する事のできる、Model-based mask data preparation (MD-MDP) 技術を提提供しています。

### 立石正博の主な略歴

1963年4月生まれ

1989年3月 慶応大学大学院修士課程（化学専攻）を終了

1989年4月 NKK（現 JFE）に入社、半導体プロセス、製造技術部門のリーダー等

1994年2月～ KLA テンコール株式会社、ウェハー検査装置ビジネスユニット責任者等

2000年1月～ PDF Solutions, Inc. 日本ビジネスデベロップメント担当副社長等

2005年1月～ プリミアテクノロジー株式会社 創立に参加、取締役

2009年6月～ ガーディアンジャパン株式会社 代表取締役社長

### Aki Fujimura (D2S Inc. Chairman 兼 CEO)

「立石氏を D2S に迎えることができ大変喜んでおります。我社は今開発段階から商業化の段階に入るところですので、彼のウェハー歩留まり向上に関する広範な見識によってカスタマとの協力関係を深めることができ、先端半導体ウェハーの歩留まりを向上する高精度マスクを、短い TAT で提供することが可能になります。」

立石正博（株式会社 D2S 代表取締役社長）

「最先端半導体のマスクの複雑さと価格は急激に上昇しており、20nm 以降のプロセス・ノードの高精度マスク製造を現実的な価格で可能にする技術の重要性は増しています。D2S は他にはない MB-MDP 技術をパートナー企業様に提供しておりますが、今回、より多くのお客様にご利用いただけます新商品 TrueMask リリースのこの時期に D2S のチームに参加することは大変光栄であり、また刺激的なことです。」

### **D2S (Design to Silicon) について：**

D2S Inc.は、少量生産・大量生産の両アプリケーション分野のマスク費用を削減するため、既存の電子ビーム・テクノロジーを最大限に生かすコンピューテーショナル・デザイン・プラットフォーム (computational design platform、高度なソフトウェアと半導体 IP を含む設計環境) を提供するベンチャー企業です。D2S の先進的な design-for-e-beam (DFEB)マスク・ソリューションは、既存の EB マスク描画装置を利用して複雑かつ曲線形状を持つ、大量生産品種用マスクの描画時間を短縮します。また、D2S の DFEB 直描ソリューションは、少量生産品種に対して実質的にマスク費用が不要となり、設計からリソグラフィまでの工程の短縮により製品の市場投入までのタイム・トゥ・マーケットを短縮します。D2S は、eBeam Initiative の事務局です。D2S は、2007 年に設立され、カリフォルニア州サンノゼ市に本社、横浜市新横浜に日本法人 (株) D2S があります。ホームページ：<http://www.design2silicon.com/>

本件に関するご連絡先：

**株式会社 D2S**

吉田憲司（取締役会長）

Tel: 045-479-8390(代)

E-mail: [kenji@design2silicon.com](mailto:kenji@design2silicon.com)

*D2S は、アメリカ合衆国の登録商標です。本報道発表内で提供されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。*